

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年2月2日(2006.2.2)

【公開番号】特開2004-177947(P2004-177947A)

【公開日】平成16年6月24日(2004.6.24)

【年通号数】公開・登録公報2004-024

【出願番号】特願2003-379504(P2003-379504)

【国際特許分類】

G 02 B 6/42 (2006.01)

【F I】

G 02 B 6/42

【手続補正書】

【提出日】平成17年12月5日(2005.12.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0041

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0041】

まず、コントローラ5が行う位置決め処理の原理について説明する。図4A～図4Cは、LDからの光の入射端面3aにおける入射位置と、LDからの光が各入射位置にあるときのX方向の光強度分布を示した図である。各図に示す入射端面3aは図面左側がX(-)方向、右側がX(+)方向である。図4Aは、LDからの光がコア3cよりもX(-)方向に入射している状態と該状態におけるLDからの光の光強度分布を示す。図4Bは、LDからの光がコア3cよりもX(+)方向に入射している状態と該状態におけるLDからの光の光強度分布を示す。図4Cは、LDからの光の入射位置がコア3cと略一致する状態と該状態におけるLDからの光の光強度分布を示す。